DEVELOPMENT OF A POLARIZATION-SWITCHING SOURCE AT THE PHOTON FACTORY, KEK

Shigeru Yamamoto^{1,A, B, C)}, Kimichika Tsuchiya^{A)}, Hiroyuki Sasaki^{A)}, Tatsuro Shioya^{A)}, Yukinori

Kobayashi^{A)}, Kentaro Harada^{A)}, Tohru Honda^{A)}, Yasunori Tanimoto^{A)}

^{A)} Photon Factory, High Energy Accelerator Research Organization, KEK

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

^{B)} Department of Materials Structure Science, The Graduate University for Advanced Studies

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

^{C)} Department of Photoscience, The Graduate University for Advanced Studies Shonan Village, Hayama, Kanagawa 240-0193

Abstract

An APPLE (Advanced Planar Polarized Light Emitter)-II type polarizing undulator, U#16-1 has been constructed and installed in the 2.5GeV PF (Photon Factory) storage ring, which has been upgraded to enhance the straight sections for insertion devices. U#16-1 and a forthcoming identical undulator comprise a polarization-switching source with a fast kicker system. U#16-1 is designed to be a soft x-ray source at the energy region from 200eV to 1keV. Details of the construction of U#16-1 and its commissioning in the PF ring are reported below.

KEK-PFにおける高速偏光切り替え光源の開発

1. はじめに

高エネルギー加速器研究機構・放射光研究施設 (KEK-PF)では、これまで2.5GeV電子蓄積リング の直線部改造を行ってきた[1]。この改造の目的は、 1997年に行った高輝度化改造で達成した低エミッタ ンスを保ちつつ、光軸不変のまま、直線部の新設お よび既存直線部の拡張を行うことである。例えば、 鉛直方向について0.5m以下のβ関数を実現可能な 1.4m直線部が4本新設される一方で、B01-02間、お よびB15-16間の5.0m直線部が8.9mに伸長された。今 後は、これらの直線部に新しい特徴ある挿入光源を 配備することが課題となる[2]。

この方向で、我々はB15-16間直線部に設置する高 速スイッチング可変偏光アンジュレータ光源の開発 を行ってきた。この光源は当初,200-1000eVのエネ ルギー領域において、10Hz程度の高い周波数で左円 偏光/右円偏光(円偏光度90%程度)を切り替える ことのできる光源として要求された。その後の検討 において、円偏光の切り替えのみでなく、直線偏光 の切り替え(鉛直/水平または+/-45°)の重要性が 強調されたため、アンジュレータ磁気回路としては これらの偏光状態も達成可能なAPPLE (Advanced Planar Polarized Light Emitter)-II型[3]を採用した。 2006-2007年度においては、光源を構成する2台のア ンジュレータのうち1台目(U#16-1)の建設を行い, 併せて高速偏光切り替えを可能にするキッカーシス テムおよび真空システムの整備を行った。これらの 加速器要素を2007年度末にPFリングに導入設置した。 ここではU#16-1の開発の詳細とPF設置後の立上げ 調整,および高速キッカーシステムを含めたB15-B16直線部の構成について報告する。

2. PFにおけるB15-B16直線部の構成

放射光ユーザーの立場からは,円偏光放射光源といえば,近年では"高速"の偏光切り替えが可能な 光源を意味するのが常識になりつつある。



図1. PF-2.5GeVリングB15-B16直線部における光源 要素の配置と,左右円偏光の切り替えの方式。

今回の光源開発では、PF-2.5GeVリングの B15-B16間直線部に2台の同一の偏光切り替えアンジュ レータを縦列に配置し、各々を異なる偏光状態に設 定した上で、5台の高速キッカー電磁石を用いるこ とでで、偏光を高速に切り替えて使用する方式を採

¹ E-mail: <u>shigeru.yamamoto@kek.jp</u>

用した。このキッカー電磁石は,積層珪素鋼板(厚 さ0.5mm)より構成され,+/-50V×100Aの容量を持 つバイポーラ電源により駆動される。この電源の周 波数帯域は10-45Hzであり目標とする10Hzでの偏光 切り替えを可能にする。図1に,B15-B16直線部に設 置する光源要素の配置と,左右円偏光の切り替えの 方式を模式的に示した。

3. 可変偏光アンジュレータU#16-1の開発

U#16-1は、PF-2.5GeVリングにおいて基本波に よって概ね200-1000eVをカバーするために56mmの 磁場周期長を採用し、周期数を44とした。



図2b. U#16-1の反対称モード。

このアンジュレータは磁気回路としてAPPLE-II 型を採用しているため、4列ある磁石列の配置の対 称性に基づいて2つの主要な動作モードを持つ:(a) 対称モードと(b) 反対称モード(図2参照)。対称 モードでは、斜め上下の磁石列を対にして、1対を 上流側に他方を下流側に軸方向に変位させる(位相 差δs)ことにより、水平直線偏光から円偏光を経て 鉛直直線偏光までの多様な偏光状態を実現できる。 一方,反対称モードでは,1対の斜め上下磁石列を 固定し、他方の上方列を上流に下方列を下流に変位 させる(位相差 δ_A)ことにより,直線偏光のまま 偏光面を水平から鉛直まで回転させることが可能で ある。図3にはU#16-1 の放射の計算スペクトルを示 した:(a)対称モード(完全円偏光時と楕円偏光時) と(b) 反対称モード(対称モードにおける直線偏光 時を含む)。

4. 磁場測定および調整

この磁石列に対する磁場調整を精密磁場測定に基づいて行った(図4参照)。この目的でホール素子を用いた精密磁場センサを製作した。このセンサは、 鉛直・水平方向の磁場を同時に測定でき、10mmまでの狭い磁石ギャップに挿入可能である。さらに、ホール出力への温度効果(温度係数 = -0.1%/K)を抑えるため、測定を行う室温領域において0.01℃の 精度で素子の温度を制御できる[4]。



図4. U#16-1の磁場調整の結果のまとめ。鉛直 (y) および水平(x) 方向の電子軌道として表した。

磁場調整は、U#16-1の4列の磁石列が全て揃った 通常型アンジュレータの磁石配列(対称モード、反 対称モードともに位相差 = 0の状態)に対して行っ た。この時、アンジュレータ各極における電子軌道 の蹴り角を調整し、最終的にほぼ理想的に近い正弦 波形の電子軌道が得られるようにした。アンジュ レータ中の電子軌道は、図4に示したように非常に 良好である。磁場調整は最小ギャップ21mmにおい て行ったが、磁場の精度はギャップの可動範囲にお いて保たれている。最終的にアンジュレータ中の磁 場の位相誤差(標準偏差)で表して+/-2度という高 い磁場精度を得ることができた。

図4は、さらに、アンジュレータ出入り口におけ る蹴り角に関しても非常に満足すべき結果が得られ たことを示している。図4から、これらの蹴り角が 絶対値も小さく、ギャップに伴うそれらの相対的変 化も非常に小さいことが判る。



図5a. U#16-1対称モードにおける位相差のの付加。



図5b. U#16-1反対称モードにおける位相差φの付加。



図6. 対称モード・完全円偏光状態における磁場 強度変更の例

U#16-1を用いるときには、ギャップを制御しつつ δ_{s} (対称モード)または δ_{A} (反対称モード)を調 整することにより、任意の磁場強度と偏光状態を選 択する。対称モードにおいて実用上重要になる、完 全円偏光状態(鉛直磁場/水平磁場=1)と楕円偏 光状態(鉛直磁場/水平磁場=2)に対して、全て のギャップでこれらの状態を達成する δ_{s} の値を確定 してある。また、反対称モードにおいて全ギャップ に対して+/-45[°]の偏光面を保つことのできるδ_Aの 値についても同様の準備を行った。

一方で、対称モードにおいて δ_s 一定のまま、下側 2列の磁石列に対して上側2列の磁石列に付加的な位 相差 φ を設けると(図5a参照)、ギャップ固定のま まで偏光状態不変のまま磁場の強度を変更すること ができる[5]。さらに、反対称モードでは $\delta_A=\delta_C$ (こ こで δ_C は対称モードにおいて完全円偏光状態を作 る δ_s の値)に設定した上で、上記の位相差 φ を付加 すると(図5b)、同じくギャップ固定のままで磁場 強度不変のまま偏光面を回転することが可能になる。

対称モード・完全円偏光状態における磁場強度変 更の例を図6に示した(ギャップ=21mmに固定)こ れらは、U#16-1の運転方法を単純化する上で実用上 非常に重要である。

5. PFリングへの設置・立上げ運転

磁場調整後のU#16-1に真空槽を装着し,2007年 度末高速キッカーシステムとともにPFリングに導 入・設置した。この真空槽(長さ2.85m)の排気に は,スパッターイオンポンプ(排気速度185liter/s) および非蒸発ゲッターポンプ(1500liter/s)を使用 した。B15-B16直線部全体の長さは約8.9mである一 方,U#16-1用真空槽を含むこの直線部の鉛直方向の 開口は15mmと狭い。この場合,B15-B16直線部全 体の真空路を全てステンレス鋼で製作すると,抵抗 壁による横方向ビーム不安定が惹き起こされる可能 性が高い[6]。この問題を予防するために,U#16-1 用真空槽(ステンレス鋼製)の電子ビームを挟む上 下面に厚さ100µmの銅鍍金を施した。

リングへの設置後,光導入を経てビームラインの 立上げ,およびU#16-1本体と高速キッカーシステム の立上げを遂行している。U#16-1の主要な運転モー ド(水平直線偏光モードおよび+/-円偏光モード 等)において,アンジュレータの独立チューニング が可能になり,すでに予備的な実験も開始されてい る。

高速キッカーシステムの立上げでは、周波数 10Hzにおける設計バンプ軌道の達成に成功した(図 1参照)。現在バンプの許容値(ビームサイズの 1/10)と同程度(水平方向)から数倍(鉛直方向) のバンプの漏れが見られる。直線部にすでに独立に 設置してある高速ステアリングを用いてこれらを抑 制することが今後の課題となる。

参考文献

- [1] T. Honda, et al., AIP Conf. Proc. 879, 87-90 (2007).
- [2] 例えば, S. Yamamoto, K. Tsuchiya and T. Shioya, AIP Conf. Proc. 879, 384-387 (2007).
- [3] S. Sasaki, Nucl. Instr. And Meth. A 347, 83-86 (1994).
- [4] S. Yamamoto et al., Rev. Sci. Instrum. 66(2), 1996-1998 (1995).
- [5] T. Schmidt and D. Zimoch, AIP Conf. Proc. 879, 404-407 (2007).
- [6] N.Nakamura, private communication.